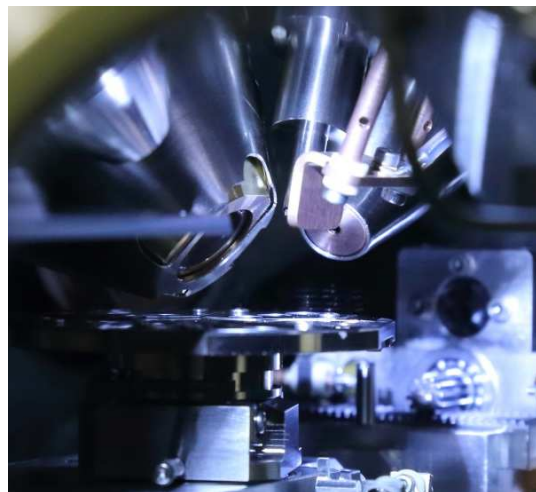


# X線光電子分光分析装置

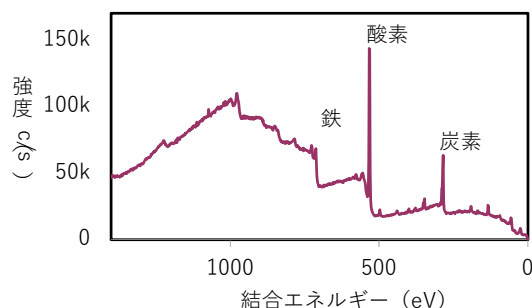
【アルバックファイ(株)製 PHI 5000 Versa Probe III】 令和2年6月導入



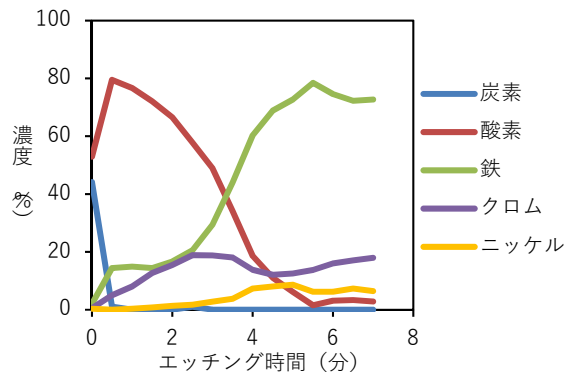
- 各種材料の極表面(数nm)の元素を分析できます。
- アルゴンイオンで表面を掘ることで深さ方向の元素分析ができます。
- オージェ電子分光分析も可能です。

仕様	
X線源	走査型マイクロフォーカスX線 (単色化AlK $\alpha$ 線, Mg/Al線)
最小X線径	10 $\mu$ m
最大走査範囲	1.4 $\times$ 1.4mm
分析対象	固体(飛散しやすい粉末や揮発成分を含む物は除きます) 例)電子部品,金属材料,ガラス等
試料サイズ	通常ホルダ: $\phi$ 60mm $\times$ 8mmT リセスホルダ: 20mm $\times$ 10mm $\times$ 13mmT
分析可能元素	ほう素 ( $_5$ B) ~ウラン ( $_{92}$ U)
オージェ用電子銃	熱電子放出形
帯電中和機構	有
エッチング方式	アルゴン単原子イオン銃
エッチング速度	10nm/分
使用方法	
	項目
委託試験	X線光電子分光分析 (オージェ電子分光分析を含む)
設備使用	X線光電子分光分析装置

【ステンレス表面の元素分析】



【ステンレスの深さ方向分析】



担当部署：化学材料表面技術部